## ピンサー型 Hf 錯体を用いたオレフィン重合反応における 対アニオンの活性点占有挙動

(名大院・情報科学 <sup>1</sup>, JST-CREST<sup>2</sup><sup>,</sup> 京大 ESICB<sup>3</sup>) ○松本 健太郎 <sup>1</sup>, K. S. Sandhya<sup>1, 2</sup>, 高柳 昌芳 <sup>1, 2</sup>, 古賀 伸明 <sup>1, 2</sup>, 長岡 正隆 <sup>1, 2, 3</sup>

## Active site occupation behavior by counter anion in olefin polymerization reaction catalyzed by pincer Hf complex

(Graduate School of Information Science, Nagoya University<sup>1</sup>, JST-CREST<sup>2</sup>, ESICB, Kyoto University<sup>3</sup>)

OK. Matsumoto<sup>1</sup>, K. S. Sandhya<sup>1, 2</sup>, M. Takayanagi<sup>1, 2</sup>, N. Koga<sup>1, 2</sup>, M. Nagaoka<sup>1, 2, 3</sup>

【序論】ピンサー型錯体の一種である (pyridylamide)Hf(IV)錯体 1 は近年、オレフィン 重合反応の触媒として注目を集めており、触媒反 応機構の実験的研究が行われている。1,2これらの 研究によれば、錯体1は図1のような活性化を経 て触媒活性を示す。錯体 1 は助触媒 B(C<sub>6</sub>F<sub>5</sub>)<sub>3</sub> 2 によって Me 基を引き抜かれてカチオンとなる。 カチオンは配位不飽和な Hf 原子を持っており、 これが活性点となって反応が進行する。一方で、 助触媒はMe基を引き抜くことで対アニオン4と なる。対アニオン4はカチオンの活性点との間に 引力性相互作用を持つため、活性化で生じるイオ ン対3では、対アニオン4が活性点を占有した構 造が安定である<sup>2,3</sup> (図 2)。従って、活性種であ るカチオンの性質のみならず、アニオンの挙動も 触媒活性に影響を及ぼすと考えられる。実際、用 いる助触媒に依存して活性が変化することが実 験的に報告されている 4,5。以上から、イオン対 の構造と振舞いが触媒の活性を決める重要な因 子であると考えられるが、その微視的な描像は明 確ではない。そこで本研究では分子シミュレーシ ョンを用いて、溶液中でのイオン対の振る舞いを 解析した。

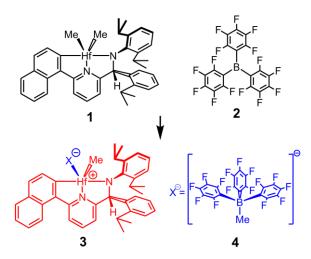


図 1: (Pyridylamide)Hf(IV)錯体 **1** の助触媒 **2** による活性化機構

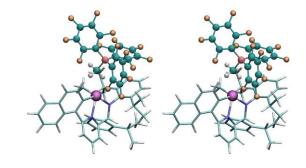


図 2:分子力場計算で得られたイオン対の 安定構造のステレオビュー

【方法】まず、密度汎関数法(DFT)を用いて活性種であるカチオンの構造と、カチオン-アニオン間、カチオン-モノマー間の引力性相互作用を調べた。汎関数にはM06を用い、基底関数はH、C、N、O 原子には6-31G(d,p)、<math>Hf 原子には有効内殻ポテンシャル基底関数 LANL2DZ と f 軌道を用い

た。DFT 計算の結果に基づいて、汎用力場 GAFF(general AMBER force field)をもとにパラメータを調製することで、カチオンの分子内力場と、カチオン-アニオン間、カチオン-モノマー間の分子間力場を開発した。そして、1 対のイオン対 3、モノマーとしてエチレン 60 分子、溶媒としてヘプタン 140 分子からなるモデル系を構築し、分子動力学(MD)計算とレプリカ交換(REMD)計算を行った。MD 計算では 400 K、1.4 MPa の NPT アンサンブルを用いて 1.2 マイクロ秒のトラジェクトリを計算し、解析した。また、REMD 計算では 392K から 800K までの 34 のレプリカを用意し、1 ピコ秒ごとのレプリカ交換を 50,000 回行った上で、400 K におけるトラジェクトリを解析した。

【結果と考察】MD 計算で得られたト ラジェクトリを解析した結果、図3 に示す機構でカチオンの活性点か ら対アニオン4が解離することを見 出した。まずメチル基とF原子を介 して対アニオン 4 が Hf 原子に配位 した構造(図3(a))から、F原子の みで配位した構造(図3(b))への 変化が起こる。その後、エチレンが 活性中心に配位しつつ、対アニオン 4 が Hf 原子から解離し (図3 (c))、 解離状態 (図 3 (d)) が生じる。こ の機構では、活性点から対アニオン 4 が解離することによる不安定化工 ネルギーが、モノマー配位による安 定化エネルギーで補償され、解離が 促進される。また、REMD 計算の結 果から、図3に示す機構が対アニオ ン4の活性点からの解離の主要な機

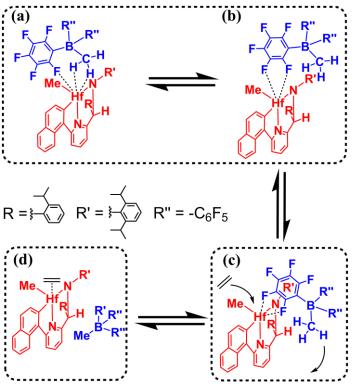


図 3:モノマーの配位と協同的に、活性点から対アニオンが解離する様子の模式図

構であることが示された。さらに、Me を用いて対アニオン 4 が Hf 原子に配位した構造 (a) からは解離が生じないことから、Me 基を有さないアニオンを用いる場合には、解離がより容易に生じ、触媒活性が向上すると推定できる。この推定は、対アニオンとして Me 基を有さない $[B(C_6F_5)_4]^-$ を用いると、より低温・短時間で重合反応が進行するという実験結果と整合している  $^{4,5}$ 。当日の発表では力場の開発を含め、図 3 の過程の詳細な解析結果を報告する。

## 【参考文献】

- [1] Froese, R.D.J.; Hustad, P.D.J; Kuhlman, R.L.; Wenzel, T.T., J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (25), 7831-7840.
- [2] Zuccaccia, C.; Busico, V.; Cipullo, R.; Talarico, G.; Froese, R.D.J.; Vosejpka, P.C.; Hustad, P.D.; Macchioni, A., *Organometallics* **2009**, 28 (18), 5445-5458.
- [3] Zuccaccia, C.; Macchioni, A.; Busico, V.; Cipullo, R.; Talarico, G.; Alfano, F.; Boone, H. W.; Frazier, K. A.; Hustad, P.D.; Stevens, J.C.; Vosejpka, P. C.; Abboud, K.A., *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130* (31), 10354-10368.
- [4] Domski. G.J.; Lobkovsky, E.B.; Coates, G.W., Macromolecules, 2007, 40 (9), 3510-3513
- [5] Busico, V.; Cipullo, R.; Pellecchia, R.; Rongo, L.; Talarico, G.; Macchioni, A.; Zuccaccia, C.; Froese, R.D.J.; Hustad, P.D., *Macromolecules* **2009**, *42* (13), 4369-4373.